

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 2 部門第 4 区分

【発行日】令和 4 年 1 月 4 日 (2022.1.4)

【公表番号】特表 2021-511990 (P2021-511990A)

【公表日】令和 3 年 5 月 13 日 (2021.5.13)

【年通号数】公開・登録公報 2021-022

【出願番号】特願 2020-561590 (P2020-561590)

【国際特許分類】

B 2 9 C 64/40 (2017.01)

B 3 3 Y 10/00 (2015.01)

B 2 9 C 64/106 (2017.01)

【F I】

B 2 9 C 64/40

B 3 3 Y 10/00

B 2 9 C 64/106

【手続補正書】

【提出日】令和 3 年 11 月 18 日 (2021.11.18)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

付加製造のための方法であって、

少なくとも 1 つの第 1 の層構造体 ( 2 1 0 ) を形成するステップと、

前記第 1 の層構造体 ( 2 1 0 ) と第 1 の支持構造体 ( 2 4 0 A ) との上に第 2 の層構造体 ( 2 2 0 ) を形成するステップと、

前記第 2 の層構造体 ( 2 2 0 ) から前記第 1 の支持構造体 ( 2 4 0 A ) を除去するステップと

を有する方法において、

前記第 1 の支持構造体 ( 2 4 0 A ) を除去する前記ステップの前に、前記第 2 の層構造体 ( 2 2 0 ) と、前記第 1 の支持構造体 ( 2 4 0 A ) 上に少なくとも部分的に配置された第 2 の支持構造体 ( 2 4 0 B ) との上に第 3 の層構造体 ( 2 3 0 ) を形成するステップと

前記第 3 の層構造体 ( 2 3 0 ) から前記第 2 の支持構造体 ( 2 4 0 B ) を除去するステップと

をさらに有し、

前記少なくとも 1 つの第 1 の層構造体 ( 2 1 0 ) を形成する前記ステップが、シャーシ底部 ( 4 2 6 ) を形成するステップを含み、

前記第 2 の層構造体 ( 2 2 0 ) を形成する前記ステップが、前記シャーシ底部 ( 4 2 6 ) にそれぞれ接続されるフェンダ ( 4 2 8 ) とサスペンションアセンブリ組付け箇所 ( 4 2 2 ) とを形成するステップであって、前記フェンダ ( 4 2 8 ) がフェンダ上部開口 ( 4 2 3 ) を規定する、ステップを含み、

前記第 3 の層構造体 ( 2 3 0 ) を形成する前記ステップが、前記第 2 の支持構造体 ( 2 4 0 B ) 上にフェンダ上部 ( 4 2 4 ) を形成するステップと、前記フェンダ上部開口 ( 4 2 3 ) を覆うステップとを含む、ことを特徴とする方法。

【請求項 2】

前記第 2 の層構造体を形成する前記ステップが、該形成するステップ中に、前記第 1 の支持構造体によって少なくとも部分的に支持されたオーバハング構造体 ( 2 2 4 ) を形成するステップを含む、請求項 1 記載の方法。

【請求項 3】

前記少なくとも 1 つの第 1 の層構造体を形成する前記ステップが、2 つの第 1 の層構造体 ( 2 1 0 A、2 1 0 B ) を形成するステップを含み、前記第 1 の支持構造体が、前記 2 つの第 1 の層構造体の間に配置されている、請求項 1 または 2 記載の方法。

【請求項 4】

前記第 2 の層構造体を形成する前記ステップが、前記第 2 の層構造体を形成する前記ステップ中に、前記 2 つの第 1 の層構造体をブリッジングしかつ該第 1 の支持構造体によって少なくとも部分的に支持されている前記第 2 の層構造体を形成するステップを含む、請求項 3 記載の方法。

【請求項 5】

前記第 2 の層構造体を形成する前記ステップ中に、前記第 1 の支持構造体と前記少なくとも 1 つの第 1 の層構造体との間にギャップが存在する、請求項 1 から 4 いずれか 1 項記載の方法。

【請求項 6】

前記第 1 の支持構造体が、前記第 2 の層構造体を形成する前記ステップ中に、前記少なくとも 1 つの第 1 の層構造体に接触しない、請求項 1 から 5 いずれか 1 項記載の方法。

【請求項 7】

前記第 2 の層構造体を形成する前記ステップが、前記第 1 の支持構造体と前記少なくとも 1 つの第 1 の層構造体とをブリッジングする前記第 2 の層構造体を形成するステップを含む、請求項 6 記載の方法。

【請求項 8】

前記少なくとも 1 つの第 1 の層構造体を形成する前記ステップが、印刷方向で 1 つ以上の第 1 の層を印刷するステップを含み、前記 1 つ以上の第 1 の層が、前記印刷方向に対して垂直方向である積層方向で積層されており、

前記第 2 の層構造体を形成する前記ステップが、前記印刷方向で 1 つ以上の第 2 の層を印刷するステップを含み、前記 1 つ以上の第 2 の層が、前記積層方向で積層されている、請求項 1 から 7 いずれか 1 項記載の方法。

【請求項 9】

前記少なくとも 1 つの第 1 の層構造体を形成する前記ステップが、前記印刷方向に対して側面角度を成す側壁を有する第 1 の層構造体を形成するステップを含み、前記側面角度が、35 度～90 度である、請求項 8 記載の方法。

【請求項 10】

前記少なくとも 1 つの第 1 の層構造体を形成する前記ステップが、前記側壁に沿って変化する側面角度を有する側壁 ( 2 1 4 ) を有する第 1 の層構造体を形成するステップを含む、請求項 8 または 9 記載の方法。

【請求項 11】

前記少なくとも 1 つの第 1 の層構造体を形成する前記ステップが、湾曲された側壁を有する前記第 1 の層構造体を形成するステップを含み、前記側面角度が、前記積層方向に沿って減少する、請求項 10 記載の方法。

【請求項 12】

前記少なくとも 1 つの第 1 の層構造体を形成する前記ステップの後であって、前記第 2 の層構造体を形成する前記ステップの前に、前記少なくとも 1 つの第 1 の層構造体から選択された距離において前記第 1 の支持構造体を位置決めするステップをさらに有する、請求項 1 から 11 いずれか 1 項記載の方法。

【請求項 13】

前記少なくとも 1 つの第 1 の層構造体と前記第 1 の支持構造体とがそれぞれ、前記第 2 の層構造体に対して近位のインタフェース面 ( 2 4 6、2 1 6 ) を有していて、前記位置

決めするステップが、前記インタフェース面が同一平面にあるように前記第 1 の支持構造体を位置決めするステップを含む、請求項 1 2 項記載の方法。

【請求項 1 4】

前記第 2 の層構造体を形成する前記ステップの前に、前記シャーシ底部に規定されたスロット内に前記第 1 の支持構造体を位置決めするステップをさらに有する、請求項 1 から 1 3 いずれか 1 項記載の方法。

【請求項 1 5】

前記第 3 の層構造体を形成する前記ステップの前に、前記第 1 の支持構造体上に前記フエンド上部開口に整合させて前記第 2 の支持構造体を位置決めするステップをさらに有する、請求項 1 から 1 4 いずれか 1 項記載の方法。